

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

บทนี้เป็นการอภิปรายและสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยประกอบด้วย ผลของอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์ ผลกระทบระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่อโครงสร้างของฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์ และผลกระทบความหนาต่อโครงสร้างของฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อภิปราย

ผลของอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจน

ฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์ชุดนี้เคลือบนแพ่นชิลิกอน ด้วยระบบ รีแอคเตฟ ดิซ์ แมกนีตรอน สปีดเตอริง โดยกำหนดให้อัตราไฮโลแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 1 sccm และแปรค่าอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2 sccm, 4 sccm และ 6 sccm ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่าเกิดฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์ทุกอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจน ส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลของอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์

1. โครงสร้างของฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์

โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่ศึกษา พิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางชีวะร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบ โดยแปรค่าอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ทั้งหมดมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เหมือนกันทุกเงื่อนไข โดยพบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 24.05° , 28.17° , 34.14° , 35.88° , 40.70° , 45.49° และ 50.09° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชอร์โโคเนียมออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1807 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ (011) , $(\bar{1}11)$, (002) , $(\bar{1}02)$, $(\bar{2}11)$, (211) และ (220) ตามลำดับ โดยที่ ระนาบ $(\bar{1}11)$ มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu, Tay, and Shao (2005) ที่พบโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ $(\bar{1}11)$ ที่มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราไฮโลแก๊สออกซิเจนในช่วง 20 - 50 sccm ในงานวิจัยนี้พบว่า สามารถเคลือบฟิล์มเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่มีความเข้มเป็นผลึกได้โดย "ไม่จำเป็นต้องให้พลังงานเพิ่ม" ซึ่งต่างจากการณ์ของ Zhao et al. (2008) ที่พบว่าฟิล์มเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบ

บันแ芬ซิลิกอนมีโครงสร้างพลีกแบบโนโนคลินิก ระนาบ ($\bar{1}11$) ที่มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด แต่ต้องให้พลังงานขณะเคลือบเพิ่มขึ้น โดยการไบแอส อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ พบว่า เมื่อเพิ่มอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน โครงสร้างพลีกของฟิล์มไม่เปลี่ยนตามอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน เพื่องจากการแปรค่าอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนในช่วงแคบเกินไป และเป็นความจำากัดของเครื่องที่ไม่สามารถใช้อัตราไหหลแก๊สออกซิเจนที่มากกว่า 6 sccm ได้เนื่องจากการทำงานของระบบสูญญากาศ ซึ่งเมื่อความดันสูงเกิน ทำให้ควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่ต่ำลดการทำงานทดลองไม่ได้ ดังนั้น จึงศึกษาอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนในช่วง $2 - 6 \text{ sccm}$ แล้วพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีความเป็นพลีกสูง ซึ่งในงานวิจัยของ Yu, Tay, and Shao (2005) ต้องใช้อัตราไหหลแก๊สออกซิเจนในช่วง $20 - 50 \text{ sccm}$ ถึงจะได้ฟิล์มที่เป็นมีความเป็นพลีก

จากผลของ XRD พบว่าฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ โครงสร้างพลีกแบบโนโนคลินิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ (Lattice constants) พบว่ามีค่า ใกล้เคียงกันทุกเงื่อนไขการเคลือบ โดยฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วยอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2 sccm พบว่ามีค่าคงที่แลตทิซเท่ากับ $a = 5.062 \text{ \AA}$, $b = 5.192 \text{ \AA}$, $c = 5.345 \text{ \AA}$, $\beta = 100.486^\circ$ ซึ่งตรงตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1807 ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่มีโครงสร้างพลีกแบบโนโนคลินิก ($a = 5.150 \text{ \AA}$, $b = 5.211 \text{ \AA}$, $c = 5.317 \text{ \AA}$, $\beta = 99.23^\circ$)

ส่วนขนาดพลีกนั้นคำนวณได้จาก Scherrer equation ซึ่งพบว่าฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแบรค่าอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน พบว่าพลีกมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีค่า ในช่วง 20.10 nm ถึง 20.48 nm

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม พิจารณาจากเทคนิค AFM ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์เคลือบท่ออัตราไหหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ พบว่าความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มของฟิล์มไม่เปลี่ยนไปตามอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น โดยพิวน้ำของฟิล์มมีเกรนลักษณะเป็นแท่งปลายแหลม เล็ก มีขนาดไม่เท่ากันกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม เช่นเดียวกันทุกเงื่อนไข สำหรับความหนาและความหมายพิวของฟิล์มพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนจาก 2 sccm เป็น 4 sccm (อัตราไหหลแก๊สสารกอนคงที่เท่ากับ 1 sccm) ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนา และความหมายพิวลดลงจาก 458 nm เป็น 328 nm และ 4.4 nm เป็น 3.1 nm ตามลำดับ และเมื่อเพิ่มอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเป็น 6 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนา และความหมายพิวเพิ่มขึ้น ต่างกับงานวิจัยของ Choi et al. (2005) ที่พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีพิวเรียบขึ้น แต่เมื่อนอกบ้งงานวิจัยของ Yu et al. (2005) ที่พบว่าอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 10 sccm เป็น 20 sccm ฟิล์มมีความหมายพิวเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนในช่วง

20 - 65 sccm ฟิล์มเซอร์โโคเนียมออกไซด์มีความขยายผิวลดลง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าความเรียบของผิวฟิล์มนี้กับอนุภาคพัลส์งานสูงที่ระดับยิง (Bombard) ผิวน้ำของฟิล์ม จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน ความหนาและถักยันะพื้นผิวของฟิล์มไม่เปลี่ยนตามอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน

จากการศึกษาผลของอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน พบว่าอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนไม่มีผลต่อโครงสร้างและถักยันะพื้นผิวของฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ ดังนั้นจึงเลือกอัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 6 sccm ไปใช้ในการทดลองต่อไป

ผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ

ฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ชุดนี้เคลือบนแผ่นซิลิกอน ด้วยระบบ รีแอคตีฟ ดีซี เมกานิตรอน สปีตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สสาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 1 sccm : 6 sccm และแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 6 cm, 8 cm, 10 cm 12 cm และ 14 cm ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เกิดฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ทุกรายละเอียด ห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ ล้วนนี้เป็นการอภิปรายผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่อ โครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลดทิช ความหนา และถักยันะพื้นผิวของฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์

1. โครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์

โครงสร้างผลึกของฟิล์ม จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ พบว่าฟิล์มนี้เคลือบได้ทั้งหมดมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 24.05° , 28.17° , 34.14° , 35.88° , 40.70° , 45.49° และ 50.09° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบเซอร์โโคเนียมออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1807 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ (011), ($\bar{1}$ 11), (002), ($\bar{1}$ 02), ($\bar{2}$ 11), (211) และ (220) ตามลำดับ โดยพบว่าเมื่อใช้ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเพิ่มขึ้น ฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ ($\bar{1}$ 11) มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ลดลง ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Gao et al. (2000) ที่พบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเพิ่มขึ้น ฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ ($\bar{1}$ 11) ที่มีความเข้ม การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงขึ้น

จากผลของ XRD พบว่าฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้มีโครงสร้างผลึกแบบ โนโนคลินิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ (Lattice constants) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันทุกเงื่อน ในการเคลือบ โดยฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแบปร่า ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 6 cm มีค่าคงที่แลตทิซเท่ากับ $a = 5.124 \text{ \AA}$, $b = 5.199 \text{ \AA}$, $c = 5.348 \text{ \AA}$, $\beta = 99.788^\circ$ ซึ่งตรงตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1807 ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ โนโนคลินิก ($a = 5.150 \text{ \AA}$, $b = 5.211 \text{ \AA}$, $c = 5.317 \text{ \AA}$, $\beta = 99.23^\circ$)

ส่วนขนาดผลึกนั้นคำนวณได้จาก Seherter equation ซึ่งพบว่าฟิล์มบางที่เคลือบโดยแบปร่า ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ พบร่วมกับผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับลดลง โดยมีค่าในช่วง 17.42 nm ถึง 22.43 nm ลดลงอย่างกับงานวิจัยของ Gao et al. (2000) ที่พบว่าผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับลดลง และอธิบายว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับลดลง ทำให้พลังงานในการสปีดเตอร์อนุภาคเพิ่มขึ้น โดยอนุภาคพลังงานสูง เคลื่อนไปยังพื้นผิว ทำให้ผลึกมีขนาดใหญ่

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม จากเทคนิค AFM ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแบปร่า ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ พบว่าที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเพิ่มขึ้น ผิวน้ำของฟิล์มนี้เกรนลักษณะเป็นแท่งปลายแหลมเล็ก มีขนาดไม่เท่ากันกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม และเกรนมีขนาดเพิ่มขึ้น เมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับลดลง สำหรับความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มพบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับลดลง ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก 170 nm เป็น 618 nm ส่วนความหยาบผิวเพิ่มขึ้นจาก 2.1 nm เป็น 4.3 nm แล้วลดลงเป็น 4.0 nm เมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 6 cm โดยขัดแย้งกับงานวิจัยของ Gao et al. (2000) ที่พบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเพิ่มขึ้น ฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบได้มีความหยาบผิว และขนาดเกรนเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ พบว่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับมีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ดังนั้นจึงเลือกระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 10 cm ไปใช้ในการทดลองต่อไป

ผลของความหนา

พิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ชุดนี้เคลือบบนแผ่นซิลิกอน ด้วยระบบ รีแอคติฟ ดีซี เมกนิตรอน สปีตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 1 sccm : 6 sccm ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 10 cm และแปรค่าความหนาจากเวลาเคลือบท่ากับ 60 นาที, 90 นาที, 120 นาที, 150 นาที และ 180 นาที ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เกิดพิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ทุกเวลาเคลือบ ส่วนนี้เป็นการอภิปราย ผลของความหนาต่อ โครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ความหนา และลักษณะพื้นผิวของ พิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์

1. โครงสร้างของพิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์

โครงสร้างผลึกของพิล์มน จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มน บางเซอร์โโคเนียมออกไซด์เมื่อใช้เวลาเคลือบต่าง ๆ พบว่าพิล์มนที่เคลือบได้ทั้งหมดมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุ่ง 24.05° , 28.17° , 34.14° , 35.88° , 40.70° , 45.49° และ 50.09° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบเซอร์โโคเนียมออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1807 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ (011) , $(\bar{1}11)$, (002) , $(\bar{1}02)$, $(\bar{2}11)$, (211) และ (220) ตามลำดับ โดยที่ระนาบ $(\bar{1}11)$ และ (002) มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงตาม ความหนาของพิล์มน ลดคล้องกับงานวิจัยของ Lai et al. (2006) ที่พบว่าพิล์มนที่เคลือบได้มี ความหนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัสดุรองรับมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยอธิบายว่าเมื่อวัสดุรองรับมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อุณภูมิเคลื่อนไปยังพื้นผิวของพิล์มนมากขึ้นทำให้เกิดการตกผลึกดีขึ้น และเมื่อพิล์มน มีความหนาเพิ่มขึ้นความน่าจะเป็นของการตกผลึกเพิ่มขึ้น

จากผลของ XRD พบว่าพิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ โครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ (Lattice constants) พบว่ามีค่า ไกลีเคียงกันทุกเงื่อนไขการเคลือบ โดยพิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าความหนา 60 นาที มีค่าคงที่แลตทิซเท่ากับ $a = 5.168 \text{ \AA}$, $b = 5.150 \text{ \AA}$, $c = 5.366 \text{ \AA}$, $\beta = 99.962^\circ$ ซึ่งตรงตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1807 ของพิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ที่มี โครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ($a = 5.150 \text{ \AA}$, $b = 5.211 \text{ \AA}$, $c = 5.317 \text{ \AA}$, $\beta = 99.23^\circ$)

ส่วนขนาดผลึกนั้นคำนวณได้จาก Seherrer equation ซึ่งพบว่าพิล์มนบางที่เคลือบโดย แปรค่าความหนา พบว่าผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นตามความหนาของพิล์มน โดยมีค่าในช่วง 17.81 nm ถึง 20.09 nm ลดคล้องกับงานวิจัยของ Zhao et al. (2008) ที่พบว่าผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นตามความหนา ของพิล์มนบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม จากเทคนิค AFM ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแบร่ค่าความหนาจากเวลาเคลือบต่าง ๆ พบร่วมกับพื้นผิวของฟิล์มกรานมีลักษณะเป็นแท่งปลายแหลมเล็ก มีขนาดไม่เท่ากันกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม และเมื่อใช้เวลาในการเคลือบนานขึ้นฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก 155 nm เป็น 502 nm ส่วนความหยาบคิ่วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.1 nm เป็น 3.6 nm ลดค่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มตามวิจัยของ Lai et al. (2006) พบร่วมกับความหยาบคิ่วเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม และอธิบายว่าเมื่อวัสดุรองรับมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทำให้ออนุภาคเคลื่อนไปยังพื้นผิวของฟิล์มซึ่งทำให้เกิดการตกผลึกดีขึ้น และเป็นไปตามทฤษฎีการเกิดฟิล์ม คือเมื่อใช้เวลาในการเคลือบนานขึ้นทำให้อะตอมของสารเคลือบตกลงบนวัสดุรองรับเพิ่มมากขึ้นทำให้ฟิล์มความมากขึ้น

จากการศึกษาผลของความหนาจากเวลาเคลือบต่าง ๆ พบร่วมกับความหนามีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ลดค่าลักษณะพื้นผิวของ Elsholz, Scho, and Rosenfeld (2004) ที่พบร่วมกับโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเปลี่ยนตามความหนาที่เพิ่มขึ้น

สมบัติทางแสง และแบบพลังงานของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์

ฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ชุดนี้เคลือบบนกระจกสไลด์ ด้วยระบบ รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 1 sccm : 6 sccm ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 10 cm และแบร่ค่าความหนาจากเวลาเคลือบท่ากับ 60 นาที, 90 นาที, 120 นาที, 150 นาที และ 180 นาที ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า ความหนาจากเวลาเคลือบต่าง ๆ มีผลต่อสมบัติทางแสง และแบบพลังงานของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลของความหนาต่อสมบัติทางแสง และแบบพลังงานของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์

1. ดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์

สมบัติทางแสงของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์ศึกษาโดยนำฟิล์มบาง

เชอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบบนกระดาษไอล์ด์ไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่อง
สเปกโตรโฟโตเมตร์ พบร่วมกับฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าการส่งผ่านแสงสูงทั้งในช่วงตามองเห็น
และอินฟราเรดใกล้ สำหรับดัชนีหักเห (k) ที่ความยาวคลื่นแสง 550 nm ของฟิล์มบางเชอร์โคเนียม<sup>ออกไซด์ที่เคลือบ โดยแบรค์เวลาเคลือบในช่วง 60 นาที ถึง 120 นาที ดัชนีหักเหมีค่าลดลงจาก
2.03 เป็น 1.97 และเมื่อเพิ่มเวลาเคลือบเป็น 150 นาที และ 180 นาที ดัชนีหักเหมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2.03
และ 2.06 ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lai et al. (2006) ที่พบร่วมดัชนีหักเหเพิ่มขึ้น เมื่อ
ความหนาฟิล์มอยู่ในช่วง 550 nm ถึง 1630 nm และลดลง เมื่อความหนาฟิล์มอยู่ในช่วง 2010 nm
ถึง 2900 nm สอดคล้องกับงานวิจัยของ Swarnalatha, Stewart, Guenther, and Carniglia (1992)
ที่พบร่วมดัชนีหักเหของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์มีค่าเท่ากับ 2.02 และ 1.92 ที่ความยาวคลื่น
350 nm และ 633 nm ตามลำดับ โดยมีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ ($\bar{1}11$) ที่มีความ
เป็นผลึกสูง</sup>

สัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) ที่ความยาวคลื่นแสง 550 nm ของฟิล์มบางเชอร์โคเนียม<sup>ออกไซด์ที่เคลือบ โดยแบรค์เวลาเคลือบท่ากับ 60 นาที และ 90 นาที มีค่าเท่ากับ 0.0003, 0.0013
แล้วลดลงเป็น 0.0006 และ 0.0005 ตามลำดับ และเมื่อใช้เวลาเคลือบท่ากับ 180 นาที สัมประสิทธิ์
การดับสูญ มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.0009 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Swarnalatha, Stewart, Guenther, and
Carniglia (1992) ที่พบร่วมสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์มีค่าเท่ากับ
0.0008 และ < 0.0003 ที่ความยาวคลื่น 350 nm และ 633 nm ตามลำดับ โดยมีโครงสร้างผลึกแบบ
โมโนคลินิก ระนาบ ($\bar{1}11$) ที่มีความเป็นผลึกสูง</sup>

2. แบบพลังงานของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์

แบบพลังงาน (E_g) ของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์ศึกษาโดยนำฟิล์มบาง

เชอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบบนกระดาษไอล์ด์ไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่อง

สเปกโตรโฟโตเมตร์ ซึ่งคำนวณได้จาก $\alpha_{(\lambda)} = A^p \sqrt{h\nu - E_g} / h\nu$ เมื่อ $p = 2$ (direct optical band
gap) โดยแบบพลังงานของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบ โดยแบรค์ค่าความหนา พบร่วม
แบบพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งมีค่าในช่วง 4.16 - 4.18 eV สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bendoraitis
and Salomon (1965) พบรูปแบบพลังงานของฟิล์มบางเชอร์โคเนียมออกไซด์ในช่วง 3.25 - 5.1 eV

สรุปผล

1. ฟิล์มเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราไอลแก๊สออกซิเจน มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกทุกเงื่อนไขการเคลือบ โดยพบว่าอัตราไอลแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการเคลือบไม่มีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์
2. ฟิล์มเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ พบว่าเมื่อใช้ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระนาบ ($\bar{1}11$) มีความเป็นผลึกลดลง โดยพบว่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับมีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์
3. ฟิล์มเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าความหนา มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก โดยที่ระนาบ ($\bar{1}11$) และ (002) มีความเป็นผลึกสูงขึ้นตามความหนาของฟิล์ม โดยพบว่าความหนามีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์
4. ดัชนีหักเห (n) และสัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) ที่ความยาวคลื่นแสง 550 nm ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าความหนา มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.06 และ 0.0009 ตามลำดับ เมื่อฟิล์มหนาเท่ากับ 502 nm โดยพบว่าความหนาไม่มีผลต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์
5. แทนพลังงาน (E_g) ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบโดยแปรค่าความหนา มีแทนพลังงานสูงสุดเท่ากับ 4.18 eV เมื่อฟิล์มหนาเท่ากับ 502 nm โดยพบว่าความหนาไม่มีผลต่อแทนพลังงานของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์